

化学工学会材料・界面部会共通基盤技術シンポジウム2014
～ 微粒子・ナノ材料の分散技術 ～

主催：化学工学会材料・界面部会

日時：2014年12月5日(金)13時～17時30分

会場：東京大学 本郷キャンパス 工学部8号館 教授会室

営団地下鉄南北線東大前駅 徒歩5分, 営団地下鉄千代田線根津駅 徒歩8分,

営団地下鉄丸の内線本郷三丁目駅 徒歩10分

案内図 http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_09_j.html

参加費：一般、部会員とも無料（交流会に参加する場合のみ、2,000円）

材料界面部会では各種材料プロセスを横断するような共通課題（基盤技術）について議論する場を、継続的に提供してきています。その議論の中から、各研究・技術における共通性を見だし、学会と産業界との連携を図り、基盤技術の体系化を図ることを目指しています。今回のシンポジウムでは液相粒子分散系における分散技術、特にボール・ミルやビーズ・ミルによる分散技術を取り上げ、いくつかの実施例から分散技術の重要性と材料創製への貢献を知り、体系化に向けた議論を行います。奮ってお申込みいただきますようお願い申し上げます。

プログラム：

13:00～13:10 開会の挨拶

材料界面部会長 東京大学 大久保 達也 氏

13:10～13:30 「微小ビーズ系での分散エネルギーと製品特性」

ビューラー(株) 前田 真志 氏

13:30～13:50 「ナノ粒子向け分散機 MAX ナノ・ゲッターの特徴」

アシザワ・ファインテック(株) 石井 利博 氏

13:50～14:10 「微粒子の分散をアシストする湿式粉碎システムの開発」

(株)マキノ 神谷 昌岳 氏

14:10～14:50 「シミュレーションを用いた粉碎機中の粒子運動の可視化技術」

(独)産業技術総合研究所 曾田 力央 氏

休憩 (14:50～15:00)

15:00～15:40 「粉体分散技術を活用した化粧品製剤・プロセスの開発」

(株)資生堂 那須 昭夫 氏

15:40～16:20 「分散・塗布技術による次世代太陽電池の開発」

御国色素(株) 瓦家 正英 氏

16:20～17:10 「濃厚コロイド系の流動・乾燥プロセスにおける技術課題」

東京大学 山口 由岐夫 氏

17:10～17:30 総合討論

交流会 (17:40～19:00) 場所：工学部2号館展示室

申込み方法・問い合わせ先

E-mailにて、氏名、所属、連絡先(E-mail, TEL, FAX) および交流会の参加の有無を明記の上、下記宛にお申込み下さい。

化学工学会 材料・界面部会事務局 脇原 徹

Tel: (03)5841-7348 FAX: (03)5800-3806

e-mail: okubo-sec@chemsys.t.u-tokyo.ac.jp

申込締切日：2014年11月14日(金)